2012 年 10 月 25 日

報道関係者　各位

会社名　　レーザーテック株式会社
東証第二部コード６９２０
横浜市港北区新横浜２－１０－１

代表者名　代表取締役社長　　岡林　理
発表担当　企画 IR 室 室長 浅井　浩志

新製品 フォトマスク欠陥検査装置

「MATRICS X700 HiT シリーズ」を発表

【概　要】

レーザーテックは、デザインノード 28nm の半導体デバイス用フォトマスクに対応する高速フォトマスク欠陥検査装置「**MATRICS X700 HiT シリーズ**」を製品化し、11 月より販売を開始します。

【背　景】

レーザーテックは、1976 年よりフォトマスク欠陥検査装置を開発・販売し，本分野で長い歴史と経験を持つ会社です。2009 年に販売を開始しました MATRICS X700 シリーズは、そのすぐれた欠陥検出性能、低ランニングコスト、および高い可用性に対して、高い評価をいただき、日本、韓国、台湾、ドイツ、米国、及び中国など全世界のウェハファブやマスクショップにてご活用いただいております。

このたび、レーザーテックは、この MATRICS X700 シリーズの検査速度を大幅に向上させた新製品「**MATRICS X700 HiT シリーズ**」を製品化しました。新設計の高性能撮像カメラと画像処理ユニットを搭載することにより、従来の高い欠陥検出性能を維持しつつ、X700 シリーズと比較して、検査時間を従来比で約 40%削減しています。

フォトマスクは、半導体デバイスの回路パターン原版という性格上、常に高い品質が要求されます。特に ArF リソグラフィを用いるウェハファブでは、フォトマスク上のヘイズ(成長性異物)の問題が依然として解決されておらず、また、半導体のさらなる微細化に伴い、フォトマスクの欠陥検査の頻度が増加し、検査速度の向上がますます強く求められています。

レーザーテックの MATRICS X700 HiT シリーズは、まさにこのようなご要望にお応えすべく製品化した装置で、より高速のフォトマスク欠陥検査を可能にしたものです。

【特　長】

- デザインノード 28nm の半導体デバイス用フォトマスクに対応可能
- マスク検査時間を従来比で 40%削減
- 独自開発の全固体 213nmQCW レーザー光源を搭載
- OHT(Overhead Hoist Transport)と連動した全自動検査が可能
- 電源・制御系統を本体に内蔵したオールインワン設計により、コンパクト化

【用　途】

- フォトマスク製造工程における出荷前検査
- ウェハファブにおけるフォトマスクの受入検査、および定期的な品質確認検査

【主な仕様】

- 検査方式　：　マルチダイモード、シングルダイモード
- 検査光　：　透過光、反射/透過光
- 検出感度　：　最高感度 25 nm
  （検出感度は、欠陥種別・検査方式により異なります）
- 検査時間　：　65 分/100mm^2
- マスクサイズ　：　6 インチ

【標準販売価格】

- 本体価格約 10 億円（価格はモデル・仕様により異なります）



MATRICS X700HiT シリーズ

◇お問い合わせ先◇
〒222-8552 横浜市港北区新横浜 2-10-1
レーザーテック株式会社　第三営業部　部長　森泉幸一
TEL:045-478-7337　FAX:045-478-7333　E-mail: sales@Lasertec.co.jp